

第4回ケミカルプロセス研究討論会

The Fourth Meeting on Chemical Processing of Ceramics

開催日： 2011年3月16日（水）

開催時間： 10:30~12:00

開催場所： M会場

主催団体名：ケミカルプロセス研究討論会

概要 開催内容： 本研究討論会ではケミカルプロセスに関する講演会を開催致します。

10:30~11:00 「電気泳動-電解重合法による無機ナノシートからの無機有機複合膜の作製とその電気化学特性」(山梨大学) 武井 貴弘

11:00~11:30 「無機ナノシートの精密集積と機能材料への応用」(物質・材料研究機構) 長田 実

11:30~12:00 「酸化ガラスからの高配向性酸化物多結晶体の作製」(岡山大学) 早川 聡

参加対象者：会員（個人・教育・シニア）、学生会員、非会員

参加費：無料

申込方法：事前申し込みは不要です

予定参加者数：30名程度

交流会（懇親会）開催予定：有 詳細当日アナウンス致します

連絡者
名前：菅原義之
勤務先：早稲田大学理工学術院
勤務先所在地：〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1
TEL：03-5286-3204
FAX：03-5286-3204
E-mail：ys6546@waseda.jp

第2回 高温電子セラミックスワークショップ

The Second Workshop on High Temperature Electroceramics

開催日： 2011年3月16日（水）

開催時間： 10:00~12:00

開催場所： B会場

主催団体名：日本セラミックス協会電子材料部会 高温電子セラミックス研究会

概要 開催内容： 高温で電子機能を発現する「高温電子セラミックス」は、セラミックスの特徴を活かした新たな展開であり、かつ産業界からは多くの期待が寄せられている。本研究会では、耐熱性を指向した電子セラミックスを「高温電子セラミックス」として整理し、今回は主にセラミックコンデンサやサーミスタに焦点をあててご講演頂きます。この機会にこの分野を代表する研究者にご講演頂くと共に、参加者間の縦断的な研究交流の輪を構築します。

参加対象者： 高温電子セラミックスに興味のある方ならどなたでも

参加費： 無料

申込方法： 下記の連絡者までE-mailにてお申し込みください。
また、当日の参加受付も可能です。

予定参加者数： 30-50名

交流会（懇親会）開催予定： 無

連絡者
名前：永田 肇
勤務先：東京理科大学
勤務先所在地：千葉県野田市山崎 2641
TEL：04-7124-1501 +3700
FAX：04-7123-0856
E-mail：nagata@takenaka.ee.noda.tus.ac.jp

講演プログラム

10:00-10:20 村山 宣光 先生（産総研）
米国 DOE プロジェクト「High Temperature Film Capacitors」の概要

10:20-11:10 内田 寛 先生（上智大）
ピスマス層状構造誘電体を用いた高温用薄膜コンデンサへのアプローチ

11:10-12:00 武田 博明 先生（東工大）
高温用非鉛 PTC サーミスタの開発と課題